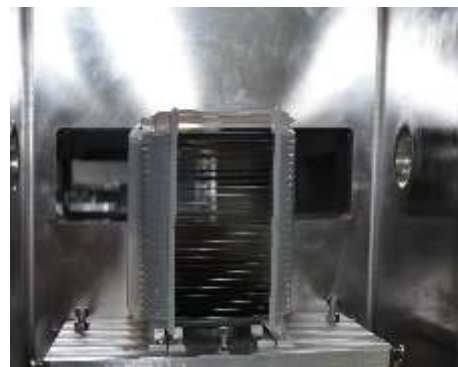


# ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СЛОЕВ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ С ИСР ИСТОЧНИКОМ И ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ ИЗ КАССЕТЫ В КАССЕТУ

## ИЗОФАЗ ТМ 200-01К

**Назначение:** Атомно-слоевое осаждение сверхтонких пленок.



### Особенности:

- Индивидуальная обработка подложек в одном технологическом цикле:  
Ø 100, 150, 200 мм - 1 шт.;
- Осаждение в термическом режиме и в режиме с удаленным источником ИСР плазмы;  
Транспортная система переноса подложек из шлюзовой камеры в рабочую камеру  
на основе манипулятора;
- Порты для подключения ампул с прекурсором:  
с высоким давлением насыщенных паров – 2 шт;  
с низким давлением насыщенных паров – 2 шт.(опционально до 4 шт);
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек из кассеты в кассету;
- Нагрев подложек до 400°C;
- Мощность потребления не более 14 кВт;
- Безмасляная система откачки;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

